

# 电子束蒸发系统

Electron Beam Evaporation System

EB900、EB700、EB500、DZS500



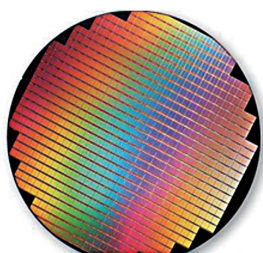
## 主要技术与性能指标

- 真空系统极限真空度： $\leq 2.6 \times 10^{-5}$  Pa；系统从大气开始抽气，20 min 可达到  $2.6 \times 10^{-4}$  Pa
- 蒸发材料：Au、Ag、Al、Cu、Si 等
- 蒸发速率范围：0.1—30 Å/s
- 膜厚均匀性： $< \pm 5\%$
- 膜厚测量：石英晶振膜厚仪，水冷探头

## 主要应用

用于金属、半导体等材料的薄膜制备

## 代表性应用成果



晶圆



触摸屏

主要用户单位	中科芯集成电路股份有限公司、天津大学、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、中国电子科技集团公司第二十六研究所等
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
联系方式	万向明 024-23826819, 13998191237 wanxm@sky.ac.cn